

超高真空用 XYマニピュレーター

XY Manipulator for Ultra-High Vacuum

MX Y

特長

Features

アルミニウム合金製にて、軽量。

アルミニウムフランジタイプは、ICF規格にて鏡面加工後、イオンプレーティング処理がされている。

超高真空対応の仕様。

直線導入機、回転導入機等との併用により多様な運動の伝達及び位置決めが可能。

クランプ機構付き。

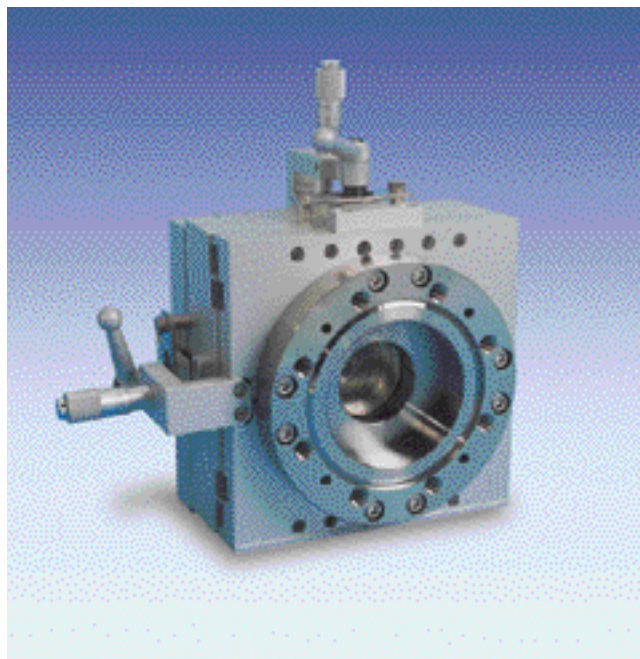
Aluminum alloy composition, lightweight design.

Ion plating process is applied to mirror finished aluminum flange according to the ICF standard.

Specifications suitable for Ultra-High Vacuum .

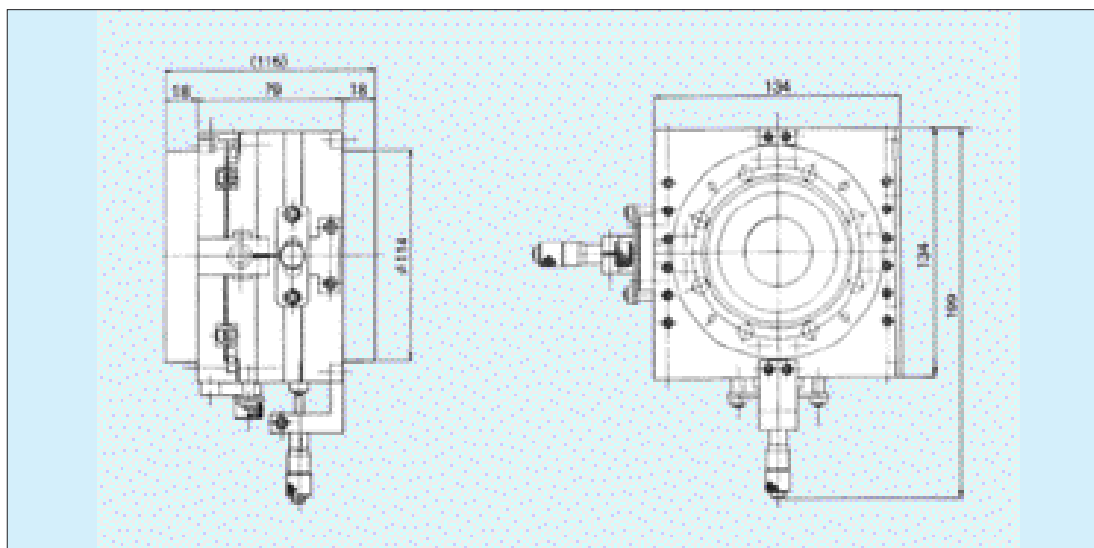
Capable of versatile transmission movement and positioning when used in combination with Linear Motion Feedthrough and Rotary Motion Feedthrough.

Clamp mechanism included.



外観図

External view drawing



仕様

Specifications

真空接続フランジ Vacuum connection flange	ICF114	
移動量 Travel range	X軸 X-axis	± 6.5mm
	Y軸 Y-axis	± 6.5mm
真空シール方式 Vacuum seal type	ベローズ方式 Bellows type	
リーク量 Leakage rate	1.3 × 10 ⁻¹¹ Pa · m ³ /sec or less (1 × 10 ⁻¹⁰ Torr · l /sec or less)	
最小読取り単位 Minimum resolution	0.01mm	
繰返し精度 Repeatability	0.01mm or less	
許容加熱温度 Maximum temperature	120 or less (A 法兰ジ flange), 250 or less (SUSフランジ flange)	

ご注文形式 MXY-114-
Order form

取付フランジ材質 A : アルミニウム Aluminum
Material of mounting flange S : ステンレス Stainless steel

本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご使用の際にはご確認ください。
標準品以外も製作しております。何なりとお問い合わせください。

Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.
Nonstandard products are available. Please inquire about other specifications.

A1 真空用マニピュレーター

A2 真空フランジ

A3 真空用ボルト・ナット

A4 真空装置

A5 その他アクセサリ

B 分析機器

C 受託業務

D 加速器・放射利用機器

E オイグーメード製品